

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 1 月 28 日 (2016.1.28)

【公開番号】特開 2014-179457 (P2014-179457A)

【公開日】平成 26 年 9 月 25 日 (2014.9.25)

【年通号数】公開・登録公報 2014-052

【出願番号】特願 2013-52293 (P2013-52293)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/60 (2010.01)

H 0 1 L 23/14 (2006.01)

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 4 3 2

H 0 1 L 23/14 R

H 0 1 L 23/12 F

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 12 月 4 日 (2015.12.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

絶縁層と、

前記絶縁層上に形成された配線パターンと、

前記配線パターンを被覆して形成された反射層と、

前記反射層の表面に設けられた発光素子搭載領域と、を有し、

前記発光素子搭載領域の前記反射層の表面には、シリカ膜が一部に形成されていることを特徴とする発光素子搭載用の配線基板。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

本発明の一観点によれば、絶縁層と、前記絶縁層上に形成された配線パターンと、前記配線パターンを被覆して形成された反射層と、前記反射層の表面に設けられた発光素子搭載領域と、を有し、前記発光素子搭載領域の前記反射層の表面には、シリカ膜が一部に形成されている。